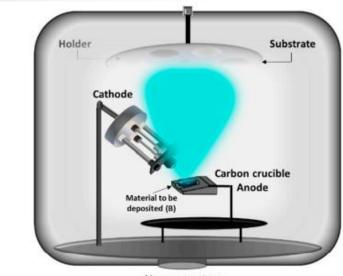
Диагностика плазмы дуги низкого давления (N_2 , 0, $1-1\Pi a$), генерируемой в условиях анодного испарения алюминия

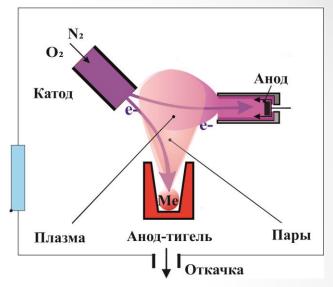
Выполнил аспирант 2 года обучения лаборатории пучков частиц Ершов Алексей Анатольевич

Анодное испарение



Vacuum system

- Принципиальное ограничение при работе в реакционных газах и повышенном давлении
- Получают только металлические покрытия
- Скорость роста покрытий более 1 мкм/ч



- Стабильная работа в реакционных средах (О2, N2, C2H2 и т.д.)
- Импульсно-непрерывный режим работы
- Получают оксидные, нитридные, композитные покрытия
- Скорость роста покрытий более 1 мкм/ч

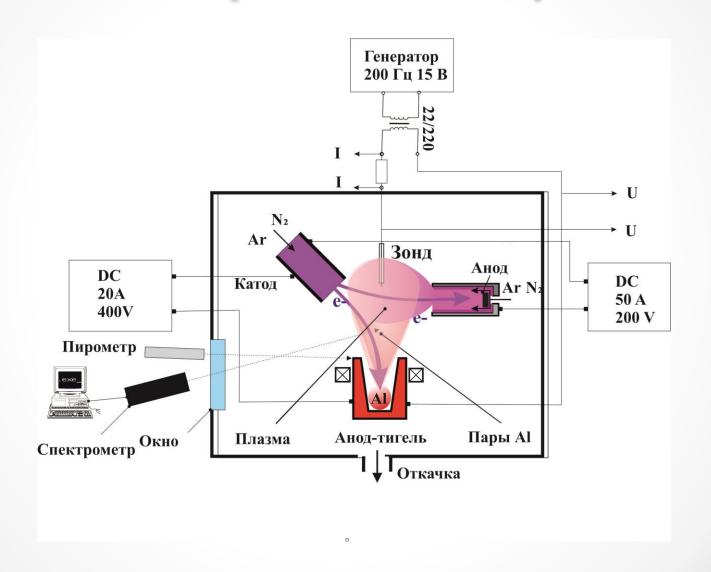
Цель и задачи работы

• <u>Целью является:</u> исследование плазмы дуги низкого давления (0.1-1 Па), поддерживаемой в электродной системе с самонакаливаемым полым катодом и анодом-тиглем

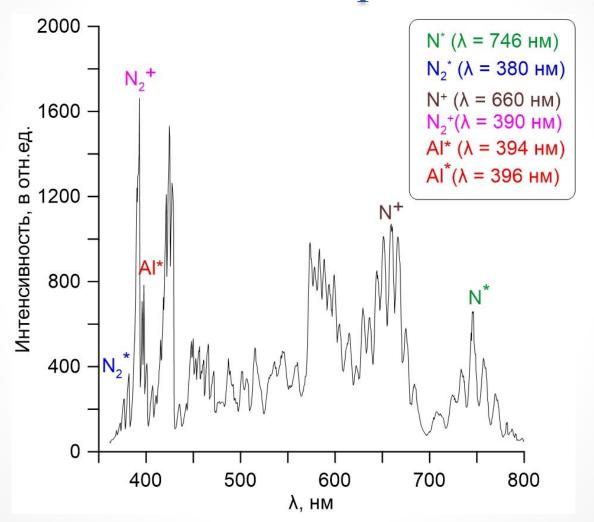
Задачи:

- Определить состав и параметры азотной плазмы разряда СНПК в широком диапазоне изменения тока разряда и давления газа
- Определить состав и параметры плазмы парогазовой среды $(N_2 Al)$
- Исследовать влияние газовой компоненты (давления и состава) на условия анодного испарения Al

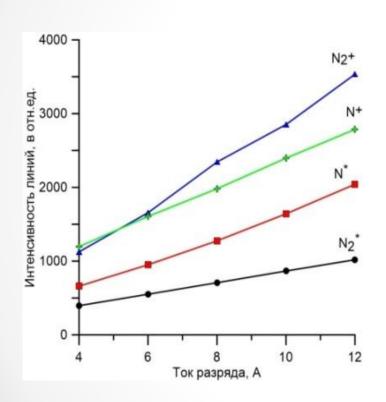
Схема экспериментальной установки

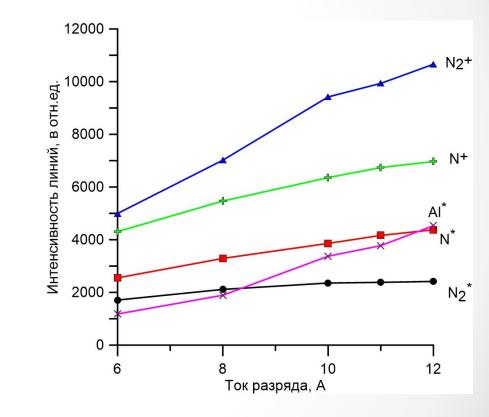


Характерный спектр оптической эмиссии плазмы парогазовой среды



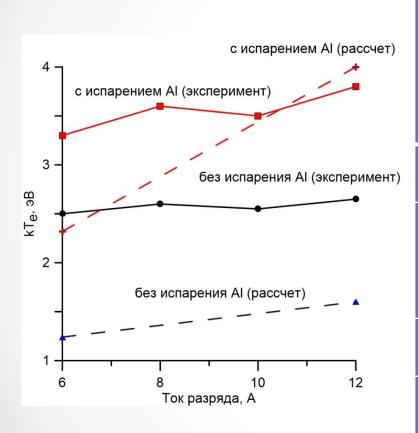
Зависимости интенсивностей линий оптической эмиссии от тока разряда





lg p = 9.2776 – 16540/T //A.H. Несмеянов. Давление пара химических элементов

Зависимости электронной температуры от тока разряда



Реакция	Выражение для константы скорости реакции K(T _e)	Литературная ссылка	Значения K(T _e) при токе разряда 10 A, см ³ /с	
	peakiim K(1 _e)		азотной среде	парогазо вой смеси
$N_2 + e -> N_2^+ + 2e$	K_1 =1.95*10 ⁻⁹ $T_e^{1.13}$ exp(- 12.1/ T_e)	Chem. Phys. 63,	5.7*10 ⁻¹⁰	2.5*10 ⁻⁹
N + e -> N ⁺ + 2e	$K_2=3.84*10^{-9}$ $T_e^{0.92}$ exp(- $14.4/T_e$)		3.8*10 ⁻¹⁰	1.9*10-9
N ₂ + e - >2N + 2e	J	P. C. Cosby, J. Chem. Phys. 98,9544 1993.	1*10 ⁻⁹	4.4*10-9
$N_2 + e - > N_2^* + 2e$	K ₄ =5.81*10 ⁻⁹ exp(-7.57/T _e)	D. C. Cartwright, S. Trajmar, A. Chutjian, and W. Williams, Phys. Rev. A 16, 1041 1977	3.2*10-9	6.7*10 ⁻⁹

Теоретическая модель

 $\frac{1}{r}\frac{d}{dr}[rve^{-\eta}] = z_ie^{-\eta}$ (1) — дифференциальное уравнение баланса частиц в плазме // A General Theory of the Plasma of an Arc / Lewi Tonks and Irving Langmuir Phys. Rev. **34**, 876 –1929

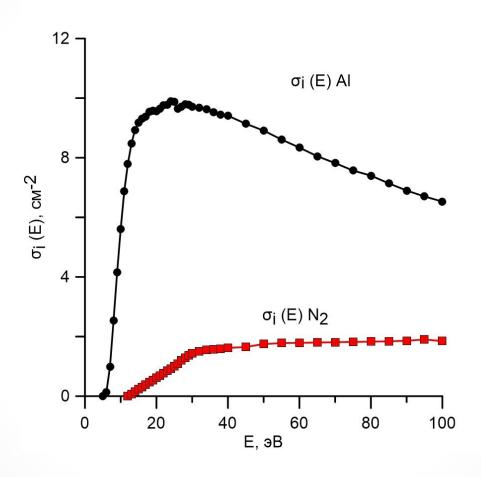
 $v = \frac{\mu_0 E}{(1 + \alpha E/p)^{1/2}}$ (2) — приближенная формула из работы Фроста для вычисления дрейфовой скорости // Effect of Variable Ionic Mobility on Ambipolar Diffusion L. S. Frost Phys. Rev. **105**, 354 –1957

•
$$z_i r = 0.24 \sqrt{\frac{2kT_g}{m_p}} \frac{\lambda_p}{r} \frac{T_e}{T_g} \left[2.4 - 0.71 \lg(2.8 \frac{\lambda_p}{r} \frac{T_e}{T_g} + 1 \right]^2$$
 (3) // Положительный столб разряда в диффузионном режиме /Захарова

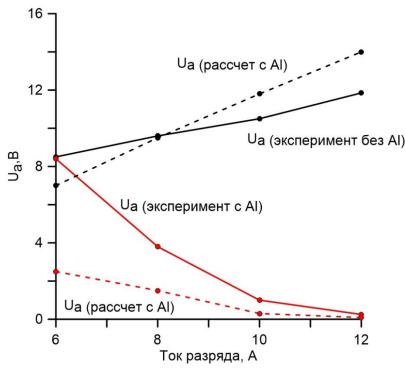
В.М., Каган Ю.М., Перель В.И., Изв. АН СССР сер. Физ. 23, 999 – 1959

$$z_i = n_g \sqrt{\frac{2}{m}} \int_{U_i}^{\infty} \sigma_i(E) f(E) \sqrt{E} dE = n_g k_i$$
 (4)

Сечение ионизации



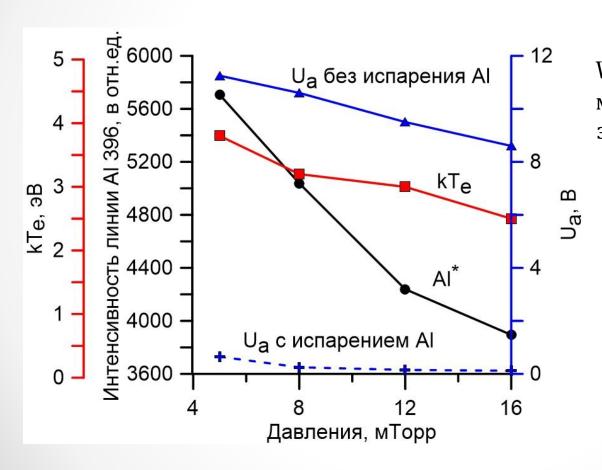
Зависимости положительного анодного падения потенциала от тока разряда



$$\frac{i_a}{p^2} = \frac{1,17}{16\pi} \frac{m_p}{m_e} \left(\frac{2e_0}{m_e}\right)^{1/2} C_1^2 U_a^{1/2} \left(U_a + \langle E_e \rangle - U_i\right)^3$$
 (5) — соотношение получено в работе Энгеля [Von Engel A. // Phil. Mag. 1941. Vol. 32. N 214. P. 417–428; A von Engel.

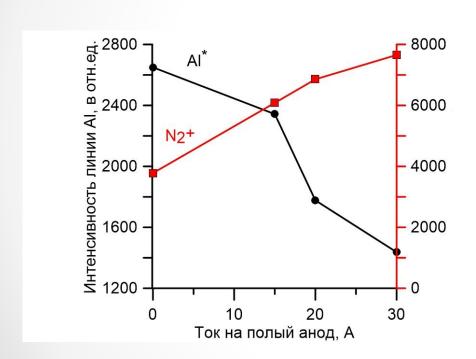
Ionized Gases. Oxford: Clarendon, 1955]:

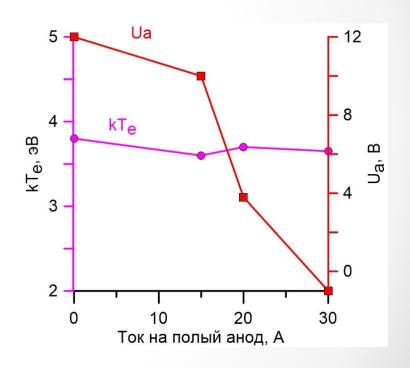
Зависимости интенсивности линии оптической эмиссии A1, положительного AП потенциала и электронной температуры плазмы от давления N_2



 $W = I_p(kT_e + U_a + \varepsilon) -$ мощность нагрева тигля за счет электронного потока

Зависимости интенсивности линий оптической эмиссии A1 и N_2^+ , положительного AП потенциала и электронной температуры плазмы от тока на полый анод





Заключение

- Исследована плазма парогазовой смеси (Al-N₂) разряда с самонакаливаемым полым катодом и испаряющимся анодом
- Показано, что поступление паров металла в разрядный промежуток повышает электронную температуру плазмы в 1,5 раза, в результате чего возрастает скорость плазмохимических реакций с участием азота
- Увеличение давления паров металла приводит к снижению величины положительного анодного падения потенциала вплоть до 0
- Влияние газовой компоненты на условия анодного испарения Al проявляется в снижении электронной температуры плазмы с ростом давления газа и величины положительного анодного падения потенциала, результатом чего является уменьшается энергия электронов, поступающих на анод, и скорость испарения металла